

# 반도체 전구체 미량 분석용 고순도 Pfa 불활성 가스 퍼징 장치, 질소 및 아르곤 호환 퍼징 시스템

품목 번호: PL-CP429



## 소개

반도체 전구체 검출 및 미량 분석용 초고순도 PFA 불활성 가스 퍼징 장치. 중요 실험실 워크플로우에서 샘플 산화 및 오염을 방지하기 위해 질소 또는 아르곤 퍼징용으로 설계되었습니다. 전문 연구를 위한 내화학성 구조로 내구성이 뛰어납니다.

## 자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 전구체 테스트	ICP-MS 분석 전에 유기금속 전구체를 아르곤으로 퍼징하여 산화를 방지합니다.	ALD/CVD 전구체의 정확한 특성 분석을 보장합니다.
IC 제조 품질 관리	공정 화학물질의 미량 금속 분석을 위한 고순도 가스 퍼징	소재 기반 오염을 제거하여 검출 한계를 낮춥니다.
배터리 전해질 연구	용매 추출 및 퍼징 과정에서 수분 민감성 리튬 배터리 부품을 보호합니다.	일관된 전기화학 테스트를 위해 전해질 안정성을 유지합니다.
촉매 합성	합성에서 분석으로 전환하는 동안 공기 민감성 촉매를 관리합니다.	대기 산소 또는 습기에 의한 촉매 중독을 방지합니다.
석유화학 미량 분석	질소 치환을 이용해 복잡한 탄화수소 매트릭스에서 휘발성 분획을 제거합니다.	거친 황 함유 화합물과 용매에 대한 내성이 뛰어납니다.
고급 나노재료 전처리	기능화 나노입자의 샘플 전처리 중 불활성 환경을 유지합니다.	표면 화학을 보존하고 의도치 않은 표면 산화를 방지합니다.
특수 가스 분석	고순도 전자 가스의 샘플링 및 분석을 위한 고순도 인터페이스로 사용됩니다.	대기 누출 또는 소재 아웃게싱으로 인한 배경 노이즈를 방지합니다.

특징	사양 세부정보 (PL-CP429)
핵심 소재	초고순도 PFA (퍼플루오로알콕시)
제조 공정	정밀 CNC 가공 / 맞춤 제작
표준 용량	30ml (요청 시 맞춤 크기 제공 가능)
가스 호환성	질소(N2), 아르곤(Ar), 헬륨(He) 및 기타 불활성 가스
내화학성	모든 일반 용매, 강산 및 염기에 대한 내성
온도 범위	특정 응용 분야의 온도 요구 사항에 따라 완전히 맞춤화 가능
압력 등급	표준 가스 퍼징 압력에 최적화된 설계 (맞춤화 가능)
연결 포트	기존 가스 라인 및 분석 기기 인터페이스에 맞춰 제작 가능
세척 프로토콜	산 세척 및 고순도 세척 절차와 호환